

лак POSITIV RESIST

Описание:

Светочувствительный лак для производства печатных плат POSITIV RESIST – светочувствительное покрытие, позволяющее фотокопировать линии, формы и контуры. Он предлагает относительно простую процедуру аккуратного переноса любого изображения на самые различные материалы. POSITIV RESIST легок в применении, быстро высыхает, обеспечивает хорошую контрастность и высокую точность.

Применение:

Производство отдельных печатных плат или их мелких серий. Изготовление лицевых панелей и вывесок, градуировка, также используется для изготовления матриц в гравировании, для травления на меди, латуни и других материалах.

Очистка: обезжирить поверхность перед нанесением.

Нанесение: с расстояния около 20 см, пока не появится видимая пленка; работать в условиях отсутствия пыли; время высыхания – 30-60 мин при 20°C, лучше – 15 мин при 70°C.

Экспонирование: лампа с высоким содержанием ультрафиолета, предпочтительно кварцевая с мягкой частью УФ спектра; время экспонирования зависит от лампы, как правило – от 30 до 60 сек.

Проявление: свежеприготовленный раствор КОН (5-7 г на 1 л воды), можно использовать кальцинированную соду более высокой концентрации, можно использовать NaOH.

Травление: хлорное железо или персульфат аммония; порядка 10 мин, перемешивая.

Смывка: ацетон.



Технические характеристики:

Цвет: густо-фиолетовый

Плотность: 0,85 г/см³

Время высыхания: 30-60 мин

Светочувствительность: 310-440 нм, максимум 330-420 нм

Объем: 200 мл.